# 电功率 20GW 重复频率强流电子束二极管研究\*

1)(中国工程物理研究院应用电子学研究所,绵阳 621900)
 2)(中国工程物理研究院北京研究生部,北京 100088)

(2007年3月4日收到;2007年3月15日收到修改稿)

采用静电场模拟对二极管结构及导引磁场位形分布进行了优化设计,并在 20 GW 脉冲功率源上进行了重复频率运行实验研究,二极管输出电子束电压超过 1 MV,电流达 20 kA,脉冲宽度 45 ns,重复频率 100 Hz,达到了设计指标.

关键词:二极管,重复频率,电子束 PACC:4180D,2921,2925B

1.引 言

重复频率强流电子束二极管是高功率微波 (HPM)源的关键部件之一,它的性能直接影响到 HPM 源的能量转换效率和微波输出功率.随着强流 脉冲技术及 HPM 技术的发展 对脉冲功率技术的要 求越来越高,不但要求整个系统有高的峰值功率,更 要求有高的平均功率,研制电功率 20 GW 脉冲功率 源是为更高输出功率的 HPM 器件研制及其相关关 键技术研究提供实验平台,而 20 GW 重复脉冲强流 电子束二极管则是该平台的重要组成部分,是其中 的关键技术之一.对于电功率如此高的重复脉冲强 流电子束二极管的研究 在国际上也是一项难度非 常大的课题.俄罗斯托木斯科大电流研究所目前只 做到了 1.5 MV/15 kA/40 ns/100 Hz<sup>[1-5]</sup>.在国内,开展 如此高指标的二极管研制工作,许多关键技术都处 于探索研究之中,本文利用静电场模拟对二极管阴 阳极、绝缘子结构及磁场位形分布等进行了优化设 计 在此基础上进行了重复频率 20 GW 强流电子束 二极管实验研究.

## 2.技术指标及总体考虑

根据 20 GW 脉冲功率源总体方案分解指标,重

\*国家高技术研究发展计划(批准号 2005AA833010)资助的课题.

复频率强流电子束二极管的技术指标为 :二极管阻 抗~50Ω,电子束能量 1 MeV,束流强度 20 kA,束流 脉冲宽度~40 ns,脉冲重复频率 100 Hz.

从总体上考虑,20 GW 二极管将采用径向绝缘 技术,其中需要重点考虑的是降低绝缘子表面及三 相(真空、绝缘子与金属)点的电场强度,同时提高输 出束流的稳定性;另外还要考虑减小回流电子对绝 缘子的轰击,避免绝缘子产生表面闪络,以延长绝缘 子使用寿命.阴极发射采用场致爆炸发射方式,阴极 端面均匀浸没在轴向磁场中.绝缘子采用锥形结构, 一方面可以延长绝缘子沿面距离,另一方面可以保 证磁力线不与绝缘子表面相交,从而避免回流电子 的轰击;引导磁场采用1 s 螺线管,用于产生并传输 强流电子束,同时利用接地电感减小或消除二极管 预脉冲干扰;分别利用电容分压器和 Rogowski 线圈 测量二极管电子束电压和电流.

### 3.物理设计及工程考虑

根据 20 GW 二极管设计要求,同时结合 CHP01 二极管研究结果以及实际应用条件<sup>[6—8]</sup>,绝缘子设 计中主要考虑以下几点:

1)选择单体绝缘子,不带均压环,简化工程 设计;

<sup>†</sup> E-mail: zhyhcaep@yahoo.com.cn

2)尽可能降低三相点的电场强度,以减少或消除初始电子的产生;

3)尽量使阴极电压沿绝缘子表面均匀下降,避 免局部产生高场强.

根据上述考虑,实际工程中二极管绝缘子采用 单体锥形结构,用尼龙 1010 材料制作,整体加工而 成.绝缘子沿面距离长为 420 mm.由于二极管引导 磁场的存在,绝缘子锥度选择除了应考虑具体制造 工艺限制之外,还应尽可能减少磁力线与绝缘子表 面相交,以避免或减少回流电子对绝缘子表面的轰 击,提高沿面闪络电压<sup>[9]</sup>.

根据马丁公式  $E_{\rm BD} t^{1/6} A^{1/10} = 175$ ,结合绝缘子设 计参数及二极管物理设计参数,计算可得绝缘子表 面闪络电压阈值  $E_{\rm BD} \approx 197$  kV/cm.考虑到二极管以 重复频率运行时,表面闪络电压阈值更低,因此设计 中取  $0.6E_{\rm BD} \approx 118$  kV/cm,即实际运行场强只要不超 过 118 kV/cm 即可保证绝缘子沿面不发生闪络.图 1 为 20 GW 二极管结构示意图.



图 1 20 GW 二极管结构示意图 1 示形成线内导体 2 示绝缘 子 3 示真空腔 4 示真空接口 5 示阴极屏蔽座 6 示 Rogowski 线 圈 7 示阴极 8 示阳极 9 示磁场

采用阴极屏蔽座可以减小三相结合点的电场强度,同时可以改善绝缘子表面的电场分布.利用静电场模拟分析,可以确定出最优的阴极屏蔽座形状及尺寸.同时,为了有效屏蔽回流电子对绝缘子的轰击及二次电子发射,阴极座形状应基本上与磁力线在此处的形状一致.

图 2 为绝缘子沿面电场分布,图 3 为二极管内 总的静电场电场模拟分布,图 4 为绝缘子沿面电场 幅值.可以看出,绝缘子沿面上的电位分布在阴极屏 蔽座的抬升下变得趋于均匀,并大大减小了绝缘子、 阴极及真空三结合点的电场强度.由模拟结果可知, 阴极座表面最大场强~246 kV/cm;绝缘子沿面电场 相对比较均匀,平均场强为 83 kV/cm,最大场强为



图 3 二极管内电场分布

图 4 绝缘子沿面电场幅值

z/cm

94 kV/cm ,三结合点电场强度达到最小((10 kV/cm), 均低于设计允许场强值.二极管内电场分布合理 ,场 强最大处在阴极尖端附近 ,有利于爆炸电子发射.

4.引导磁场设计

引导磁场的设计与阴阳极结构的设计是紧密相 关的,磁场的位形分布决定着阴极电子的发射和传 输<sup>[10-13]</sup>.设计中要求磁力线尽可能不与绝缘子沿面 直接相交,以减小或消除回流电子对绝缘表面的轰 击,同时,必须使阴极发射端面完全沉浸在磁场均匀 区,而且磁场大小必须满足电子束稳定传输条件,以 使电子束保持低发散度.图 5 为由设计的二极管几 何尺寸及电子束参数所确定的磁场幅值和相对位置 分布曲线.

实际设计中,磁场由 16 个螺线管串、并联组成, 线圈内径为 77 mm,均由漆纸绝缘的截面积为 2 mm×5 mm的铜线绕制,线圈电阻为 0.35 Ω.各线 圈之间留有绝缘缝隙,利用变压器油循环冷却.图 6 为实测螺线管磁场位形.







图 6 1 s 磁场实测位形

### 5.实验研究

在理论研究及粒子模拟的基础上,利用设计的 二极管和螺线管磁场,在 20 GW 脉冲功率源上进行 了重复频率电子束二极管初步实验研究.以下给出 的是二极管以 100 Hz 重复频率运行时输出的电压、 电流波形及单次打靶图像.

其中图 ((a)中 CH1 为经时间轴压缩之后的电 压波形,CH2 为经时间轴压缩之后的电流波形,图 ((b)为 100 次电压电流波形展开后的重叠图像.其 中上面为电压波形,下面为电流波形.由实验波形可 以看出,二极管可以在 100 Hz 重复频率下稳定运 行 输出电子束能量超过 1 MeV,电流超过 20 kA,脉 冲宽度约 45 ns,达到设计指标.图 ((c)为束斑图像. 通过测量二极管输出电子束的束斑几何尺寸,可以 判定电子束的质量完全符合设计要求,满足 HPM 器 件研究需求.



图 7 二极管重复频率输出波形及束斑 (a)示序列(b)示重 叠(c)示束斑

## 6.总 结

通过静电场模拟,对强流电子束二极管绝缘子 形状、阴阳极结构、磁场位形等进行了优化设计,利 用 20 GW 脉冲功率源进行了初步实验研究.实验结 果表明,设计的二极管很好地解决了三结合点的场 击穿和绝缘子表面的真空闪络问题,设计的引导磁 场完全满足实际应用的需要,二极管输出电子束能 量超过 1 MeV,电流超过 20 kA,脉冲宽度约 45 ns,重 复频率达到 100 Hz.

在实验测试中,对于重复频率输出波形的测量 都是取其平均值,然后对每一个脉冲波进行详细测 量,包括幅值及脉宽,最后进行偏差概率统计,发现 20 GW 二极管输出电压最大偏差小于4.5%,电流最 大偏差小于5%,均满足 HPM 器件实验要求.

- [1] Korovin S D , Rostov V V 1996 Russian Physics Journal 39 1177
- [2] Mesyats G A, Shpak V G, Yalandin M I 1991 Proc. 8-th IEEE Int. Pulsed Power Conf. San Diego, USA 73
- [3] Mesyats G A , Korovin S D , Rostov V V 2004 Proc. of the IEEE 92 1166
- [4] Gubanov V P, Gunin A V, Korovin S D 2001 IEEE Conf. of Pulsed Power Plasma Science p336
- [5] Mesyats G A , Korovin S D , Gunin A V 2003 Laser and Particle Beams 21 197
- [6] Michael E J , Lester E T 1980 J . Appl . Phys . 51 5212
- [7] Zhang Y H, Ma Q S, Chang A B, Zhou C M, Gan Y Q, Liu Z.
  2004 High Power Laser and Particle Beams 16 1437(in Chinese)
  [张永辉、马乔生、常安碧、周传明、甘延青、刘 忠 2004 强激
  光与粒子束 16 1437]
- [8] Ma Q S , Zhang Y H , Chang A B , Zhou C M 2005 High Power Laser

and Particle Beams 17 609 (in Chinese) [马乔生、张永辉、常安碧、周传明 2005 强激光与粒子束 17 609]

- [9] Gennady A M 1991 IEEE Trans. on Plasma Sci. 19 683
- [10] Zhang Y H, Chang A B, Xiang F, Gan Y Q, Liu Z, Zhou C M 2005 High Power Laser and Particle Beams 17 1423 (in Chinese) [张永辉、常安碧、向 飞、甘延青、刘 忠、周传明 2005 强激 光与粒子束 17 1423]
- [11] Zhang Y H, Ma Q S, Xiang F, Gan Y Q, Chang A B, Liu Z, Zhou C M 2005 Acta Phys. Sin. 54 3111 (in Chinese)[张永辉、马乔 生、向 飞、甘延青、常安碧、刘 忠、周传明 2005 物理学报 54 3111]
- $\left[ \begin{array}{c} 12 \end{array} \right] \ Liu \ G \ Z$  , Huang W H , Yang Z F 2005  ${\it Chin}$  .  ${\it Phys}$  . 14 949
- [13] Xia L S , Zhang H , Chen D B , Zhang K Z , Shi J S , Zhang L W 2005 Chin . Phys. 14 1779

# Repetition rate of intense current electron-beam diodes using 20 GW pulsed source \*

Zhang Yong-Hui<sup>1,2,)†</sup> Chang An-Bi<sup>1,)</sup> Xiang Fei<sup>1,)</sup> Song Fa-Lun<sup>1,)</sup> Kang Qiang<sup>1,)</sup>

Luo Min<sup>1</sup>) Li Ming-Jia<sup>1</sup>) Gong Sheng-Gang<sup>1</sup>)

1 X Institute of Applied Electronics, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China) 2 X Postgraduate Department, China Academy of Engineering Physics, Beijing 100088, China)

(Received 4 March 2007; revised manuscript received 15 March 2007)

#### Abstract

Based on the static electric-field simulation, the structures of 20 GW diode and its insulator, as well as the position and shape of guide magnetic-field are designed and optimized. Then the experiments on the repetition rate of intense current electron-beam diode are carried out on 20 GW pulsed power source, it can deliver intense electron-beam pulses of 1MV/20 kA with pulse width 45 ns and repetition rate 100 Hz.

Keywords : diode , repetitive frequency , electron-beam PACC : 4180D , 2921 , 2925B

 $<sup>\</sup>ast$  Project supported by the National High Technology Joint Research Program of China ( Grant No. 2005AA833010 ).

 $<sup>\</sup>ensuremath{^{\ddagger}}$  E-mail : zhyhcaep@yahoo.com.cn